



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार | The Patent Office, Government Of India
पेटेंट प्रमाण पत्र | Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) | (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 444995

आवेदन सं. / Application No. : 201621006604

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 25/02/2016

पेटेंटी / Patentee : NORTH MAHARASHTRA UNIVERSITY

आविष्कारकों का नाम / Name of Inventor(s) : 1.PROF. ASHOK M. MAHAJAN 2.MR. VILAS S. PATIL 3.DR. LALIT S. PATIL

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित *PLASMA ENHANCED ATOMIC LAYER DEPOSITION SYSTEM AND METHOD OF USE* नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख फरवरी 2016 के पच्चीसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled *PLASMA ENHANCED ATOMIC LAYER DEPOSITION SYSTEM AND METHOD OF USE* as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 25th day of February 2016 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



(Signature)
पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patents

अनुदान की तारीख : 14/08/2023
Date of Grant :

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, करवी 2018 के पच्चीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देव होगी।
Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 25th day of February 2018 and on the same day in every year thereafter.